

ケミカルシフトを用いた自然酸化層膜厚測定

柳内克昭

Katsuaki Yanagiuchi

TDK株式会社 開発研究所

TDK Corporation,

113, Nenei, Nagano 385

H F 処理し、酸化層を除去したポリシリコン膜を大気中に放置した後、形成される自然酸化層膜厚測定に $S i 2p$ のケミカルシフトを利用した。表面汚染の影響を受けない

実用的な方法として提案する。この場合、自然酸化層は放置 8 時間までは、認められず、放置 24 時間から、しだいに増加する様子が観測された。